УДК 544.72,542.87,542.97

МОДЕЛЬ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В КРИСТАЛЛЕ В АКТАХ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМОВ ВОДОРОДА НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКА

© 2020 г. Д. В. Гранкин¹, А. И. Бажин², В. П. Гранкин^{1, *}

¹Приазовский государственный технический университет, Мариуполь, Украина ²Харьковский национальный университет, Харьков, Украина *E-mail: victor.grankin@gmail.com Поступила в редакцию 09.01.2020 г. После доработки 07.02.2020 г. Принята к публикации 26.02.2020 г.

Представлены теоретические исследования явления генерации неравновесных электронов в полупроводниковых структурах под действием гетерогенной химической реакции рекомбинации атомов водорода. Найдена теоретически возможная эффективность преобразования химической энергии в электрическую с помощью полупроводниковых гетероструктур. Описан микромеханизм генерации хемотока в приближении многоквантового колебательно-электронного перехода.

DOI: 10.31857/S0367676520060137

ВВЕДЕНИЕ

Процессы рассеяния энергии на поверхности в момент времени, когда только происходит акт образования возбужденного продукта в экзотермической каталитической реакции, является неотъемлемой частью физики и химии поверхности [1]. Экзотермическая химическая реакция, как и падение фотонов на поверхность, может приводить к электронному возбуждению кристалла [2]. Для металлов создание электронно-дырочных ($e^{-}-p^{+}$) пар под действием химической реакции предсказано теоретически [3], а затем экспериментально зарегистрировано с помощью диода Шоттки [2] и появилась идея создания генераторов тока с прямым преобразованием химической энергии в электрическую. Аккомодация энергии химической реакции по электронному каналу раньше, чем в металлах, была обнаружена в полупроводниках и диэлектриках. Об этом свидетельствуют явления гетерогенной хемилюминесценции (ГХЛ) [4] и хемоэлектрические эффекты под действием реакции [5].

В работе [6] был обнаружен эффект увеличения на несколько порядков величины вероятности аккомодации энергии гетерогенной химической реакции по электронному каналу за счет облучения образца УФ светом (системы: атомарный водород – ZnS; ZnS, CdS–Ag). Это связано с эффективной передачей энергии реакции электронам на электронных ловушках, которые заселяются за счет УФ облучения [6]. В работе [7] предложен метод определения и установлена зависимость константы скорости аккомодации энергии реакции по электронному каналу от энергии электронного перехода в твердом теле. Это дает основу для расчета эффективности неадиабатического хемоэлектронного преобразования энергии в структурах для водородной энергетики на основе диода Шоттки и полупроводниковых гетероструктур.

Однако выход ГХЛ и хемотока в диодах Шоттки для известных систем газ-поверхность мал и лежит в интервале 10⁻²-10⁻⁶ [2, 4]. Поэтому диоды Шоттки и полупроводниковые гетероструктуры не рассматриваются, как возможные генераторы хемотока и работы по отысканию таких систем с высоким выходом электронных возбуждения не проводятся. Это связано также с тем, что считается, что основным каналом аккомодации энергии химической реакции на полупроводниках является фононный канал. Имеются лишь единичные исследования по определению вероятности электронного возбуждения полупроводника энергией реакции от энергии электронного перехода в кристалле [7]. С этим связано, что неизвестны функции распределения неравновесных электронов по энергиям в кристалле и функциональные зависимости выхода хемотока, не построен механизм возбуждения хемотока.

Вместе с тем для описания ГХЛ разработан многоквантовый колебательно-электронный механизм [8] в рамках которого, по-видимому, можно попытаться описать хемоток, что являлось одной из задач исследования, так как оба явления связаны с электронным возбуждением полупроводника за счет химической реакции. Кроме этого, целью работы было: определение вероятности аккомодации энергии химической реакции по электрон-



Рис. 1. Механизм генерации хемотока в полупроводниковой гетероструктуре. E_g – ширина запрещенной зоны, E_f – уровень Ферми, E_c – дно зоны проводимости, E_v – потолок валентной зоны.

ному каналу от энергии электронного перехода в твердом теле и теоретически возможного предельного выхода неадиабатического хемоэлектронного преобразования энергии в полупроводниковых гетероструктурах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Электронное возбуждение кристалла возникает при протекании на его поверхности большого числа экзотермических химических реакций Вследствие сложности, которая присуща большинству химических реакций Г. Нинхаус предложил в качестве модельного процесса для изучения электронной хемогенерации использовать моноатомные газы (водород) [2].

Энергия, выделившаяся в реакции водорода на поверхности, может рассеиваться неадиабатически, приводя к прямому возбуждению e^--p^+ пар. На рис. 1 представлена энергетическая диаграмма создания e^--p^+ пары в реакции адсорбции и рекомбинации атомов Н и химически индуцированного тока в структуре катализатор реакции полупроводник *p*-типа—полупроводник *n*-типа.

Если толщина фронтального слоя полупроводника *p*-типа мала, меньше длины пробега электрона в нем, то созданные на поверхности в результате реакции неравновесные электроны в *p*-полупроводнике и находящиеся в непосредственной близости от области объемного заряда, увлекаются электрическим полем *p*-*n*-перехода и попадают в *n*-область. Через *p*-*n*-переход и внешний проводник будет течь ток (хемоток), обусловленный генерацией e^--p^+ пар в *p*-области за счет химической реакции на поверхности.

Адсорбция и рекомбинация атомов водорода на поверхности приводит к возникновению высоковозбужденного продукта реакции, горячих атомов Н и колебательно-возбужденных молекул

 $H_2^{v}L$, релаксация которых может сопровождаться электронным возбуждением поверхности [9]. Например, генерация хемотока в диодах Шоттки с фронтальной поверхностью Pt, Pd, происходит за счет энергии адсорбции атомов H [2], а в диодах Ta-TaO_x-Au за счет рекомбинации атомов H на поверхности Au [10]. На неметаллах за электронное возбуждение кристаллов в основном отвечает реакция рекомбинации атомов H [11] (хотя в некоторых случаях возможно электронное возбуждение и в актах адсорбции атомов H [9]). О том, что релаксация колебательно-возбужденных молекул сопровождается электронным возбуждением кристалла, свидетельствует эмиссия электронов с поверхности α -Al₂O₃ при воздействии пучка

молекул H_2^{v} [12] и обнаружение "горячих" электронов, покидающих металлическую поверхность, когда колебательно-возбужденные молекулы NO сталкиваются с поверхностью Cs. При этом, эмиссия e^- происходит только тогда, когда колебательная энергия превышает работу выхода электронов с поверхности [13]. Это говорит о том, что горячая молекула H_2 может эффективно передавать энергию колебаний электронной подсистеме материала. С учетом этого, кинетическая модель, которая описывает возбуждение e^--p^+ пар в полупроводнике в результате взаимодействия атомарного водорода с поверхностью, имеет вид:

 $H + L \xrightarrow{\nu_1} HL$,

$$H + HL \xrightarrow{v_2} H_2^{v}L \xrightarrow{m} \underbrace{\qquad}_{\Gamma_1} H_2 + L + p^+ + \underbrace{\stackrel{P_1}{\underset{P_n}{\longrightarrow}} e^-(E_1)}_{P_n} e^-(E_n)$$

Здесь HL – адсорбированный атом водорода, L – свободный от адсорбированных частиц центр поверхности катализатора, $e^{-}(E_i)$ – возбужденный за счет реакции электрон в зоне проводимости *p*-полупроводника с энергией E_i относительно потолка валентной зоны, *ph* – генерируемый за счет реакции фонон в твердом теле, p^+ – дырка в валентной зоне, P_i – вероятность генерации электрона с энергией E_i в расчете на элементарный

акт (на одно колебание ядер в H_2^vL) в результате передачи колебательной энергии от H_2^vL электронным состояниям в кристалле. Над стрелками обозначены: v_1 , v_2 – вероятности адсорбции и рекомбинации атомов Н на катализаторе, соответственно, Γ_1 – вероятность релаксации H_2^vL по фононному каналу в расчете на элементарный акт, *m* – среднее число потенциально возможных актов релаксации H_2^vL в результате колебательноэлектронного обмена за время жизни H_2^vL на поверхности.

Введем обозначения: [HL] $\rightarrow N_1$, [L] $\rightarrow N$, [H₂^vL] $\rightarrow N_2^v$, $e^-(E_i) \rightarrow n_i$. Из кинетической модели:

$$n_{1} = mP_{1}v_{2}N_{1}$$

$$n_{i} = mP_{i}v_{2}N_{1}$$

$$(1)$$

$$\overline{n = \sum n_{i} = mPv_{2}N_{1}},$$

где величина n_i — число электронов с энергией E_i , генерируемых в зону проводимости за счет реакции на 1 см² поверхности за 1 секунду, n – общее число неравновесных электронов, генерируемых за счет реакции на 1 см² поверхности за 1 секунду. В (1) учтено, что $\sum_{i=1}^{n} P_i = P$. Из (1) величина $P_i = n_i/m\omega$, где $\omega = v_2 N_1 -$ скорость реакции на поверхности. Вследствие того, что энергетические уровни в зоне проводимости расположены квазинепрерывно, рассчитанная на элементарный акт релаксации $H_2^{v}L$ вероятность dP генерации электрона, который имеют энергию в интервале dE в окрестности значения энергии Е, вычисляется по формуле dP = f(E)dE, где f(E) - функция распределения по энергиям электронов в полупроводнике, которые генерируются в зону проводимости в экзотермической химической реакции на поверхности. В работе [7] впервые эксперимен-

тально найден вид зависимости для вероятности генерации высокоэнергетических электронов в твердом теле энергией гетерогенной химической реакции (рекомбинации атомов водорода):

$$f(E) = A\exp(-E/\Theta_{char})$$
(2)

и найдена величина Θ_{char} для этих систем: $\Theta_{char} = 0.173$ эВ. Здесь E — энергия перехода электрона в полупроводнике, Θ_{char} — характеристическая энергия реакции, A — предэкспоненциальный множитель. Предэкспоненциальный множитель найдем из условия, что вероятность релаксации возбужденного продукта реакции на элементарный акт на поверхности узкозонного полупроводника с $E_g \rightarrow 0$ близка к 1, как на металлах [14]. Из условия нормировки и с учетом экспериментальной зависимости (2) имеем:

$$P(E_g \to 0) = \int dP = \int_0^\infty f(E) dE =$$
$$= \int_0^\infty A \cdot \exp(-E/\Theta_{char}) dE = 1.$$

Отсюда предэкспоненциальный множитель $A = 1/\Theta_{char}$ и функция f(E) распределения по энергиям неравновесных электронов, генерируемых за счет реакции в полупроводнике, имеет вид:

$$f(E) = \frac{1}{\Theta_{char}} \exp\left(-E/\Theta_{char}\right).$$
 (3)

Тогда вероятность на элементарный акт релаксации $H_2^{\nu}L$ по электронному каналу равна:

$$P(E \ge E_g) = \int_{E_g}^{\infty} f(E) dE = \exp(-E_g / \Theta_{char}).$$
(4)

Из кинетической модели и с учетом выражения (4) выход хемотока α (выход высокоэнергетических электронов с $E \ge E_{g}$ и образующих ток в цепи) равен:

$$\alpha = mP/(mP + m\Gamma_1) = \frac{m\exp(-E_g/\Theta_{char})}{m\exp(-E_g/\Theta_{char}) + m\Gamma_1}.$$
 (5)

Рассмотрим два предельных случая. Пусть вероятность релаксации колебательно-возбужденного продукта реакции по фононному каналу Γ_1 много больше вероятности релаксации $H_2^{\nu}L$ по электронному каналу ($\Gamma_1 \ge P$). Тогда, с учетом того, что $mP + m\Gamma_1 = 1$, выход хемотока

$$\alpha = mP = m \cdot \exp\left(-E_g \big/ \Theta_{char}\right), \tag{6}$$

описывается экспоненциальной зависимостью и быстро убывает с увеличением E_g . Величина α тем больше, чем больше значение Θ_{char} (рис. 2). Например, при $E_g = 1.0$ эВ и $\Theta_{char} = 0.173$ эВ значение $\alpha/m = 2.7 \cdot 10^{-3}$, а при $E_g = 1.0$ эВ, но $\Theta_{char} = 0.1$ эВ, величина $\alpha/m = 3.7 \cdot 10^{-5}$, т.е. почти на 2 порядка величины меньше.

В случае если $\Gamma_1 \ll P$, т.е. когда неэффективен фононный канал аккомодации энергии реакции, то из (5) $\alpha \approx 1$ и каждый акт реакционного взаимодействия должен приводить к генерации e^--p^+

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ том 84 № 6 2020



Рис. 2. Зависимость приведенной величины выхода хемотока α/m (расчет) от ширины запрещенной зоны полупроводника при различных значениях характеристической энергии реакции Θ_{char} : 1 - 0.1 эВ; 2 - 0.14 эВ; 3 - 0.173 эВ; 4 - 0.21 эВ; 5 - 0.26 эВ.

пары, независимо от ширины запрещенной зоны,

так как в этом случае релаксация H^v₂L возможна только по электронному каналу. То есть для полупроводников с малыми Г₁ выход хемотока должен значительно превышать α хемогенераторов на диоде Шоттки, где в основном генерируются горячие электроны с энергией меньше высоты барьера Шоттки. Этим, очевидно, объясняется то, что выход электронных возбуждений на акт химического взаимодействия в узкозонных полупроводниках выше, чем выход хемотока в диодах Шоттки. Например, в системе Н-Ge он равен 0.3 [5], тогда как α для диодов Шоттки с $\phi = 1 - 1.5$ эВ 10⁻⁵-10⁻³ [2]. Это указывает на перспективность разработки хемогенераторов тока с прямым преобразованием химической энергии в электрическую на полупроводниковых структурах, по сравнению с диодами Шоттки.

В соответствии с экспериментальными результатами для системы H–Ge [5] и выражением (5) mP = 0.3, $m\Gamma_1 = 0.7$. То есть релаксация возбужденного продукта реакции на Ge происходит как по электронному, так и по фононному каналу. С учетом (4) для системы H–Ge среднее число воз-

можных попыток (*m*-фактор) релаксации H_2^vL в результате колебательно-электронного обмена за

время жизни $H_2^{\nu}L$ на поверхности равно:

$$m = 0.3/\exp\left(-E_g/\Theta_{char}\right).$$
 (7)

Сделаем оценку *m*. Для германия $E_g = 0.665$ эВ, величину $\Theta_{char} = 0.173$ эВ возьмем, как для системы H–ZnS, CdS–Ag; H–ZnS. Тогда из (7) *m* = 14. Таким образом время жизни колебательно-воз-

бужденной молекулы Н^у₂L на поверхности Ge достаточно велико, и она совершает около десятка колебаний до ее релаксации. Это связано с тем, что при большой теплоте реакции (порядка 1 эВ) и обычных температурах Дебая твердых тел освобождающаяся в акте реакции энергия велика по сравнению с энергией даже наиболее высокочастотных фононов (порядка 10⁻² эВ), так что размен теплоты реакции на фононы весьма затруднен. На поверхности в этом случае образуется долгоживущее (в масштабе времен жизни однофононных возбуждений) неравновесное колебательное состояние с временем жизни $\tau_V \gg 10^{-13}$ с. Большой продолжительности жизни Н₂^vL кроме его "высокочастотности" способствует простота структуры продукта реакции, поскольку малое число

внутренних степеней свободы в H_2^vL затрудняет "внутреннее" возбуждение продукта. Последний обладает латеральной мобильностью и диффундирует вдоль поверхности до потери колебательно-возбужденным продуктом реакции избытка энергии [9, 14]. Таким образом, при условии, что $\Theta_{char} = 0.173$ эВ, то электронный канал аккомодации энергии реакции атомов Н будет преимущественным на полупроводнике с $E_g \le 0.5$ эВ и $m \ge 15$. В свою очередь последнее возможно для полупроводников с малой Γ_1 .

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ГЕНЕРАЦИИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И ХЕМОТОКА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Источником энергии, стимулирующим электронное возбуждение полупроводника, служит процесс образования новых связей при захвате атомных частиц поверхностью — адсорбции и рекомбинации атомов Н. Для водорода эта энергия вначале сосредоточена на вновь образованной химической связи и имеет форму высоковозбужденного колебательного движения ядер

 $(H_2^{\nu}L)$. Возникающее при движении ядер электронно-колебательное взаимодействие может инициировать неадиабатические электронные переходы [12].

В работе [8] для описания электронных процессов в полупроводниках и диэлектриках, возникающих за счет гетерогенной реакции на поверхности, предложен механизм многоквантового колебательно-электронного перехода. При колебательном возбуждении во вновь образованной химической связи значительно возрастает ангармонизм колебаний и дипольный (квадрупольный) момент связи. Находящиеся в статической области колебательно-возбужденного диполя электроны кристалла способны перейти в возбужденное состояние за счет преобразования энергии нескольких колебательных квантов в энергию электронных возбуждений. Такой переход возможен в первом порядке разложения зависимости дипольного момента возбужденной связи от межъядерных координат при учете ангармонизма колебаний. По данному механизму [8], вероятность возбуждения электрона с энергией

Е в полупроводнике при релаксации $H_2^{v}L$ равна:

$$P(E) = B \cdot \exp(-Ep/\hbar\omega_0), \qquad (8)$$

где *B* – предэкспоненциальный множитель, который слабо зависит от энергии *E* электронного перехода в твердом теле, $\hbar\omega_0 = 0.545$ эВ – энергия колебательного кванта H₂ на первом колебательном уровне, *p* – ангармонический фактор, который вычисляется по формуле [8]:

$$p = \frac{x \ln x}{x - 1}, \quad x = \frac{4q + \hbar\omega_0}{\varepsilon_{mn} + \hbar\omega_0}.$$
 (9)

Здесь q — энергия связи атомов в молекуле, ε_{mn} — энергия чисто колебательного перехода. Из сравнения выражений (8) и (4) видно, что

$$\Theta_{char} = \hbar \omega_0 / p \,. \tag{10}$$

Тогда функция распределения электронов по энергиям, генерируемых в полупроводнике химической реакцией, в соответствие с (3), равна

$$f(E) = \frac{p}{\hbar\omega_0} \exp\left(-Ep/\hbar\omega_0\right). \tag{11}$$

Выход хемотока, в соответствие с (5), равен:

$$\alpha = m \cdot \exp(-E_g p / \hbar \omega_0). \tag{12}$$

В данном приближении величина α должна зависеть как от параметров твердого тела, реагирующего газа, так и механизмов реакции. Сделаем оценку α для системы H-Ge, используя выражение (12). Для этой системы $E_g = 0.665$ эВ, $\hbar \omega_0 =$ = 0.545 эВ, q = 4.48 эВ (энергия связи атомов в H₂). Из (9) при $\varepsilon_{mn} = 0.7$ эВ x = 14.8 и p = 2.9. Подставив эти значения в (12), имеем $\alpha^{theor} = m^{theor} \cdot 2.9 \cdot 10^{-2}$. Значение α^{theor} , будет равно α , найденному из выражения (5) и экспериментальных данных для системы H–Ge, при $m^{theor} = 10.3$, т.е. α^{theor} отличается от α менее чем в 1.5 раза. Данное различие можно считать незначительным, т.к. Θ_{char} в расчетах бралась как для системы H-ZnS, CdS-Ag; H-ZnS. Кроме того, если за электронное возбуждение отвечает, например реакция адсорбции атомов Н на Ge, сопровождающаяся образованием горячих атомов, то Θ_{char} этой реакции будет иной.

Полученные результаты показывают, что вероятность электронного возбуждения полупроводника энергией реакции будет больше, по сравнению с металлом, т.к. невозможна релаксация возбужденных продуктов реакции за счет генерации электронов с энергией меньше E_g и лишь их релаксация по фононному каналу ограничивает число переходов зона—зона в полупроводнике. Этим, очевидно, объясняется то, что выход электронных возбуждений в полупроводниках [5] выше, чем α в диодах Шоттки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обнаруженные в последнее время явления, такие как хемоэлектрические эффекты в полупроводниках [5], генерация хемотока в диодах Шоттки [2] свидетельствуют о том, что электронная полсистема в кристалле является полноправным участником релаксационных процессов в системе газ - поверхность и указывают на потенциальную возможность преобразования химической энергии в электрическую с помощью гетероструктур. Найденная зависимость функции распределения по энергиям электронов, генерируемых в полупроводнике за счет химической реакции на поверхности, позволяет рассчитать возможную вероятность электронного возбуждения полупроводника энергией реакции (если известны Г₁, Θ_{char} , *m*, *E*_g или *m*, *E*_g, $\hbar\omega_0$, *p* для рассматриваемой системы газ-поверхность), которая при определенных параметрах системы может стремиться к 1. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования полупроводниковых гетероструктур для построения устройств для прямого преобразования энергии химической реакции в электрическую (например, как генераторов тока для водородной энергетики). Для этого необходимо обязательное выполнение двух основных требований: полупроводник фронтальной поверхности гетероструктуры должен иметь малые значения Г₁ и являться катализатором реакции окисления водорода. Другие условия: узкозонные полупроводники, возбужденные продукты реакции на поверхности имеют высокие локальные частоты колебаний, сильный ангармонизм колебаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Park J.Y., Baker L.R., Somorjai G.A. // Chem. Phys. 2015. V. 115. P. 278.
- 2. Nienhaus H. // Surf. Sci. Rep. 2002. V. 45. P. 3.
- 3. Bruko R., Newus D.M. // J. Phys. C. 1981. V. 14. Art. № 30065.
- 4. Волькенштейн Ф.Ф., Горбань А.Н., Соколов В.А. РРЛ полупроводников. М.: Наука, 1976. 278 с.

- 5. Тюрин Ю.И., Кабанский А.Е., Стыров В.В. // Теор. экспер. химия. 1984. Т. 20. № 6. С. 682; *Tyurin Yu.I.*, *Kabanskii A.E., Styrov V.V.* // Theor. Exper. Chem. 1985. V. 20. № 6. Р. 639.
- 6. Гранкин В.П. // Кин. катализ. 1996. Т. 37. С. 863; Grankin V.P. // Kinet. Catal. 1996. V. 37. P. 802.
- 7. Гранкин В.П., Гранкин Д.В. // ЖФХ. 2016. Т. 90. C. 950; Grankin V.P., Grankin D.V. // Russ. J. Phys. Chem. 2016. V. 90. P. 1280.
- Tyurin Yu.I., Nikitenkov N.N., Sigfusson I.T. et al. // Int. J. Hydrog. Energy. 2017. V. 42. Art. № 12448.
- Grankin D.V., Grankin V.P., Styrov V.V. et al. // Chem. Phys. Let. 2016. V. 647. P. 145.

- 10. Schindler B., Diesing D., Hasselbrink E. // J. Chem. Phys. 2011. V. 134. Art. № 034705.
- 11. *Стыров В.В., Тюрин Ю.И.* Неравновесные хемоэффекты на поверхности твердых тел. М.: Энергоатомиздат, 2003. 507 с.
- Гранкин В.П., Савинков Н.А., Стыров В.В. и др. // ЖЭТФ. 1990. Т. 98. С. 226; Grankin V.P., Savinkov N.A., Styrov V.V. et al. // Sov. Phys. JETP. 1990. № 71. Р. 125.
- White J.D., Chen J., Matsiev D. et al. // Nature. 2005. V. 433. P. 503.
- 14. *Novko D., Blanco-Rey M., Juaristi J.I., Alducin M. //* Phys. Rev. B. 2015. V. 92. Art. № 201411.